

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載  
 【部門区分】第 5 部門第 3 区分  
 【発行日】平成 19 年 4 月 26 日 (2007.4.26)

【公表番号】特表 2006-524309 (P2006-524309A)  
 【公表日】平成 18 年 10 月 26 日 (2006.10.26)  
 【年通号数】公開・登録公報 2006-042  
 【出願番号】特願 2006-507005 (P2006-507005)  
 【国際特許分類】

**F 2 6 B 21/04 (2006.01)**

**F 2 6 B 13/02 (2006.01)**

**F 2 6 B 21/12 (2006.01)**

【F I】

F 2 6 B 21/04 A

F 2 6 B 13/02

F 2 6 B 21/12

【手続補正書】

【提出日】平成 19 年 3 月 7 日 (2007.3.7)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

不特定長さの移動する基材を処理するための装置であって、

(a) 前記基材の表面に密に近接し、前記基材との間に制御間隙を画定する、制御表面と、

(b) 前記制御表面の近くに位置するとともに気体導入デバイスを有する第 1 のチャンバと、

(c) 前記制御表面の近くに位置するとともに気体取出しデバイスを有する第 2 のチャンバとを含み、前記制御表面および前記第 1 および第 2 のチャンバが、隣接した気相がある量のマス<sub>1</sub>を有する領域を画定し、前記領域内の前記マス<sub>1</sub>の少なくとも一部が移送されたときに  $M_1 + M_1' + M_2 + M_3 = M_4$  を満足し、

ここで、 $M_1$  は、圧力勾配から生じる、前記領域内へのまたは前記領域からの単位幅あたりの総正味時間平均マスフローを意味し、

$M_1'$  は、前記気体導入デバイスから前記第 1 のチャンバを通る前記領域内への、単位幅あたりの気体の総正味時間平均マスフローを意味し、

$M_2$  は、前記基材の少なくとも 1 つの主面からまたは前記基材の少なくとも 1 つの主面内への、前記領域内への、単位幅あたりの時間平均マスフローを意味し、

$M_3$  は、前記材料の動きから生じる、前記領域内への単位幅あたりの総正味時間平均マスフローを意味し、

$M_4$  は、単位幅あたりの、前記気体取出しデバイスを通るマス移送の時間平均速度を意味する、装置。

【請求項 2】

不特定長さの移動する基材を処理するための方法であって、

(a) 制御表面を、前記基材と前記制御表面との間に制御間隙を画定するように、前記基材の表面に密に近接して配置する工程と、

(b) 気体導入デバイスを有する第 1 のチャンバを前記制御表面の近くに位置決めする

工程と、

( c ) 気体取出しデバイスを有する第 2 のチャンバを、前記制御表面および前記第 1 および第 2 のチャンバが隣接した気相がある量のマスを有する領域を画定するように、前記制御表面の近くに位置決めする工程と、

( d ) 前記領域内の前記マスの少なくとも一部を、 $M1 + M1' + M2 + M3 = M4$  を満足するように移送する工程とを含み、

ここで、 $M1$  は、圧力勾配から生じる、前記領域内へのまたは前記領域からの単位幅あたりの総正味時間平均マスフローを意味し、

$M1'$  は、前記気体導入デバイスから前記第 1 のチャンバを通る前記領域内への、単位幅あたりの気体の総正味時間平均マスフローを意味し、

$M2$  は、前記基材の少なくとも 1 つの主面からまたは前記基材の少なくとも 1 つの主面内への、前記領域内への、単位幅あたりの時間平均マスフローを意味し、

$M3$  は、前記材料の動きから生じる、前記領域内への単位幅あたりの総正味時間平均マスフローを意味し、

$M4$  は、単位幅あたりの、前記気体取出しデバイスを通るマス移送の時間平均速度を意味する、方法。